(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51).Int. Cl.
H01L 21/324(2006.01)

(11) 공개번호 00-0000-0000000
(43) 공개일자 0000년00월00일

(21) 출원번호 10-2002-7008534
(22) 출원일자 2002년06월00일
심사청구일자 2005년12월00일
번역문 제출일자 2002년06월00일
(86) 국제출원번호 PCT/JP2005/000000
국제출원일자 2005년08월00일
(87) 국제공개번호 WO 2006/000000
국제공개일자 2006년03월00일

(30) 우선권주장 PCT/JP2004/000000 2004년08월00일 세계지적재산권기구(WIPO)(WO)
(71) 출원인 김출원
미국 캘리포니아 00000-00000 서니베일 피.오.박스 0000 메일 스톱 68
(72) 발명자 기타자키 가즈히로
일본 0000000 도쿄 신주쿠-구 니시-신주쿠 0-쪼
(74) 대리인 김대리
전체 청구항 수 : 총xx항

(54) 발명의 명칭

(57) 요약

대표도 - 도4

... 중략...

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 OOO와 같은 기재의 OOO 방법에 관한 것으로, 이 열처리 방법은 OOO를 열처리 장치 내로 도입하는 것을 포함하고, 상기 열처리 장치는 OOO의 도입 위치와 평행한 2개의 실질적으로 편평한 부분을 포함하며, OOO가 사이에 수용되는 이들 2개 부분 중 제1 부분은 고온인 제x 온도로 가열하고, 열처리의 실행을 위해 OOO의 양 측부로 가스 흐름을 각각 공급한다.

배 경 기 술

그러한 방법은 OOOOO OOOOO의 WO 98/00000으로부터 공지되어 있다. 그러한 OOO 장치에서는 OOO와 반응 장치의 부분 사이에서 강한 열적 결합이 일어날 수 있기 때문에, OOO를 도입할 때 매우 신속한 워밍업이 가능한 것으로 생각된다. 다양한 공정에 있어서, 어떤 반응이 제어되지 않는 상태로 계속되는 과도 기간이 가능한 한 짧게 유지되도록 가열이 신속하게 일어나는 것이 중요하다.